(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平11-65105

(43)公開日 平成11年(1999)3月5日

	.,,,,,,		審査請求 未請求 請求項の数9 OL (全 35 頁) 最終頁に続く
G03F	7/038	601	G 0 3 F 7/038 6 0 1
B41C	1/055	5 0 1	B 4 1 C 1/055 5 0 1
		503	5 0 3 Z
		501	5 0 1
G03F	7/004	506	G03F 7/004 506
(51) Int.Cl. ⁶		識別記号	F I

(22)出願日 平成9年(1997)11月13日

(31) 優先権主張番号 特願平9-156828 (32) 優先日 平 9 (1997) 6 月13日

(33)優先権主張国 日本(JP)

コニカ株式会社

東京都新宿区西新宿1丁目26番2号

(72)発明者 服部 良司

東京都日野市さくら町1番地コニカ株式会

社内

(54) 【発明の名称】 画像形成材料及び画像形成方法

(57) 【要約】

【課題】 近赤外~赤外線領域による露光で画像形成が可能で、特に該領域に発光領域を有するレーザーを用いて記録することによりコンピューター等のデジタルデータから直接製版が可能で、該領域に対する感度が高く、かつドット変動抑制性を有するポジ型或いはネガ型の直接製版用画像形成材料の提供。又該領域に発光領域を有するレーザーを用い画像形成材料に画像を形成する方法の提供。

【解決手段】 皮膜量10以上60mg/m²以下の陽極酸化皮膜を有する金属支持体上に、活性光線の照射により酸を発生し得る化合物、酸により架橋する基を有する化合物及び赤外線吸収剤を含有する感光層を有してなることを特徴とする画像形成材料。皮膜量10以上60mg/m²以下の陽極酸化皮膜を有する金属支持体上に、活性光線の照射により酸を発生し得る化合物、酸により分解し得る結合部を有する化合物及び赤外線吸収剤を含有する感光層を有してなることを特徴とする画像形成材料。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 皮膜量10以上60mg/dm²以下の陽極酸化皮膜を有する金属支持体上に、活性光線の照射により酸を発生し得る化合物、酸により架橋する基を有する化合物及び赤外線吸収剤を含有する感光層を有してなることを特徴とする画像形成材料。

【請求項2】 皮膜量10以上60mg/dm²以下の陽極酸化皮膜を有する金属支持体上に、活性光線の照射により酸を発生し得る化合物、酸により分解し得る結合部を有する化合物及び赤外線吸収剤を含有する感光層を 10有してなることを特徴とする画像形成材料。

【請求項3】 金属支持体上に、皮膜量0.001以上10mg/m²以下の断熱層、活性光線の照射により酸を発生し得る化合物、酸により架橋する基を有する化合物及び赤外線吸収剤を含有する感光層を有してなることを特徴とする画像形成材料。

【請求項4】 金属支持体上に、皮膜量0.001以上10mg/m²以下の断熱層、活性光線の照射により酸を発生し得る化合物、酸により分解し得る結合部を有する化合物及び赤外線吸収剤を含有する感光層を有してな20ることを特徴とする画像形成材料。

【請求項5】 上記断熱層が支持体と感光層との間に設けられていることを特徴とする請求項3又は4記載の画像形成材料。

【請求項6】 上記断熱層が現像液可溶な樹脂を有してなることを特徴とする請求項3乃至5の何れか1項記載の画像形成材料。

【請求項7】 上記金属支持体の表面の中心線平均粗さ (Ra)が0.3以上0.7μm以下、平均粗さ (Rz)が3.0以上6.0μm以下であり、感光層を除去 30 した際の支持体の表面エネルギーγ (H:水素結合力)が、下記式で15以上50dyncm以下であることを 特徴とする請求項1乃至6の何れか1項記載の画像形成 材料。

γ (H) d y n/cm=[(1.159+2.159× cos(接触角: H₂O) - cos(接触角: CH² 2 I₂)]/0.379²

(接触角はH₂O:1.7μl、CH₂I₂:1.3μl を滴下し30秒後に測定)

【請求項8】 上記金属支持体がアルミニウム板である 40 ことを特徴とする請求項1乃至7の何れか1項記載の画 像形成材料。

【請求項9】 請求項1乃至8の何れか1項記載の画像 形成材料の感光層を有する表面を活性光線を照射して画 像を形成することを特徴とする画像形成方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、オフセット印刷マスターとして使用可能なポジ型、或いはネガ型の画像形成材料に関し、更に詳しくは、近赤外~赤外線に領域を 50

有する半導体レーザー等を用いて記録することにより、 コンピューター等のデジタルデータから直接製版できる ダイレクト製版用の平版印刷板として用いられる画像形 成材料に関する。又、前記画像形成材料に画像を形成す る方法に関する。

[0002]

【従来の技術】従来、活性光の照射によって可溶化する ポジ型の感光層として、酸発生剤と酸分解性化合物とを 含有する感光層を有する画像形成材料が知られている。 即ち、米国特許第3,779,778号明細書には、酸 発生剤と酸で分解する特定の基を有する水不溶性化合物 とを含有する感光性組成物が、特開昭53-13342 9号には、酸発生剤と主鎖にアセタール又はケタール基 を有する化合物とを含有する感光性組成物が、又特開昭 60-37549号には、酸発生剤とシリルエーテル基 を有する化合物とを含有する組成物が開示されている。 これらはいずれも紫外線に感度を有し、紫外線による露 光によってアルカリ可溶化して非画像部を形成し、又未 露光部は画像部を形成するというものである。一般的に は、マスクフィルム等を介してハロゲンランプ、高圧水 銀灯などから照射紫外線により画像露光を行なってお り、アルゴンレーザー、ヘリウムーカドミウムレーザー などの短波長レーザーによる露光も可能であるが、装置 が高価で大きいため使用の際は煩わしい場合もあり、又 感光材料の感度の点でも十分満足のいくものばかりでは なかった。

【0003】感光層の感度向上を図るために本発明者らは粘度の異なる混合溶剤を添加したポジ型感光材料(特願平7-152623号)或いは感光体に対する良溶剤/貧溶剤からなる混合溶剤を添加したポジ型感光材料(特願平7-158580号)を提案したが、紫外線による画像露光では依然として上記したようなハード面での問題が残り、安価で簡易な方法が望まれていた。

【0004】一方、安価でコンパクトな半導体レーザー のような赤外線で画像露光が可能な技術として、酸発生 剤、レゾール樹脂、ノボラック樹脂及び赤外線吸収剤を 含有する感光層を有する画像形成材料を画像露光の後、 現像処理前に加熱処理を施すことによりネガ型の画像を 形成する方法が米国特許第5,340,699号明細書 に開示され、又上記加熱処理を施さない場合はポジ型の 画像形成材料として使用される技術が開示されている。 又特開昭53-133429号には、酸発生剤、酸で分 解する化合物及び青色染料(クリスタルバイオレット) とを含有する感光層を有する画像形成材料について開示 されている。しかしながらこれらの技術は、レーザー光 が支持体表面の反射により散漫になりやすく本来の画像 を呈しない即ちドットゲインの変動が大きく、良好な画 像を得ることが困難である。特に支持体としてアルミニ ウム等の金属板を使用した平版印刷板に半導体レーザー で露光した場合、レーザーが反射して熱エネルギーが散

乱してドットゲインが低下し、優れた感度を得られず画 像形成に大幅な負荷を生じさせるという問題を有してい た。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】本発明は上記事情に鑑みてなされたものであり、その目的は近赤外~赤外線領域による露光で画像形成が可能で、特に該領域に発光領域を有するレーザーを用いて記録することによりコンピューター等のデジタルデータから直接製版が可能で、該領域に対する感度が高く、かつドット変動抑制性を有す 10 るポジ型或いはネガ型の直接製版用画像形成材料を提供することである。又該レーザーを用い画像形成材料に画像を形成する方法を提供することである。

[0006]

【課題を解決するための手段】本発明の上記目的は、以 下の構成により達成された。

【0007】〈1〉皮膜量10以上60mg/dm²以下の陽極酸化皮膜を有する金属支持体上に、活性光線の照射により酸を発生し得る化合物、酸により架橋する基を有する化合物及び赤外線吸収剤を含有する感光層を有20してなることを特徴とする画像形成材料。

【0008】〈2〉皮膜量10以上60mg/dm²以下の陽極酸化皮膜を有する金属支持体上に、活性光線の照射により酸を発生し得る化合物、酸により分解し得る結合部を有する化合物及び赤外線吸収剤を含有する感光層を有してなることを特徴とする画像形成材料。

【0009】〈3〉金属支持体上に、皮膜量0.001 以上10mg/m²以下の断熱層、活性光線の照射により酸を発生し得る化合物、酸により架橋する基を有する 化合物及び赤外線吸収剤を含有する感光層を有してなる 30 ことを特徴とする画像形成材料。

【0010】〈4〉金属支持体上に、皮膜量0.001以上10mg/m²以下の断熱層、活性光線の照射により酸を発生し得る化合物、酸により分解し得る結合部を有する化合物及び赤外線吸収剤を含有する感光層を有してなることを特徴とする画像形成材料。

【0011】好ましい態様として、上記断熱層が支持体と感光層との間に設けられていること、上記断熱層が現像液可溶な樹脂を有してなること、上記金属支持体の表面の中心線平均粗さ(Ra)が0.3以上0.7μm以 40下、平均粗さ(Rz)が3.0以上6.0μm以下であり、感光層を除去した際の支持体の表面エネルギーγ

(H:水素結合力)が、下記式で15以上50dyn/cm以下であること

γ (H) d y n/cm= [(1. 159+2. 159× c o s (接触角: H₂O) - c o s (接触角: CH ₂I₂)]/0. 379²

(接触角は $H_2O: 1.7\mu$ l、 $CH_2I_2: 1.3\mu$ l を滴下し30秒後に測定)、上記金属支持体がアルミニウム板であること、が挙げられる。

【0012】〈5〉上記の画像形成材料の感光層を有する表面を活性光線を照射して画像を形成することを特徴とする画像形成方法。

【0013】即ち本発明者らは、近赤外~赤外線に発光 領域を有する半導体レーザー等を用いて記録することに より、コンピューター等のデジタルデータから直接製版 が可能であり、該領域に対する感度が高く、かつドット 変動抑制性に優れたヒートモード書き込み型ダイレクト 製版用画像形成材料を得るべく鋭意検討した結果、レー ザー露光を効率良く行うためには金属支持体表面を断熱 するのが効果的であるとの知見に基づき、本発明に至っ たものであり、該支持体表面に特定皮膜量の断熱層或い は特定皮膜量の陽極酸化皮膜を設けることにより達成し たものであり、その結果本発明の目的を達成しえる性能 を有するというものである。

【0014】以下、本発明を詳細に説明する。

【0015】本発明は画像形成材料及び該画像形成材料 に画像を形成する方法をその要旨とするものであり、以 下、順に説明する。

【0016】〔1〕画像形成材料

本発明の画像形成材料はその形態により2つに大別でき、第1の態様として、皮膜量10以上60mg/dm²以下の陽極酸化皮膜を有する金属支持体上に、活性光線の照射により酸を発生し得る化合物、酸により分解し得る結合部を有する化合物及び赤外線吸収剤を含有する感光層を有してなるもの(ポジ型)が、又ネガ型として、上記の形態において酸により分解し得る結合部を有する化合物の代替に、酸により架橋する基を有する化合物を用いるものである。

【0017】第2の態様として金属支持体上に、皮膜量 0.001以上10mg/m²以下の断熱層と、活性光 線の照射により酸を発生し得る化合物、酸により分解し 得る結合部を有する化合物及び赤外線吸収剤を含有する 感光層とを有してなることを特徴とし(ポジ型)、ネガ 型として、上記の形態において酸により分解し得る結合 部を有する化合物の代替に、酸により架橋する基を有す る化合物を用いるものである。

【0018】本発明は高感度かつドット変動抑制性に優れた効果を奏するために支持体表面に特徴を持たせたものであり、以下支持体について説明する。

【0019】〈支持体及び断熱層、陽極酸化皮膜〉本発明に用いられる金属支持体としては、アルミニウム、亜鉛、鋼、銅等の金属板、並びにクロム、亜鉛、銅、ニッケル、アルミニウム、鉄等がメッキ又は蒸着された金属板等が挙げられる。特にアルミニウム支持体は好ましく、純アルミニウム及びアルミニウム合金よりなる支持体が挙げられ、該合金としては種々のものが使用でき例えば、ケイ素、銅、マンガン、マグネシウム、クロム、亜鉛、鉛、ビスマス、ニッケル等が挙げられる。

【0020】これらのうち本発明に用いられる支持体に

は、砂目立て処理、陽極酸化処理及び必要に応じて封孔 処理等の表面処理等が施されているアルミニウム板を用 いることが好ましい。これらの処理は公知の方法を適用 できる。

【0021】アルミニウム支持体は、粗面化に先立ってアルミニウム表面の圧延油を除去するために脱脂処理を施すことが好ましい。脱脂処理としては、トリクレン、シンナー等の溶剤を用いる処理、ケシロンとトリエタノール等のエマルジョンを用いたエマルジョン処理等が挙げられる。又苛性ソーダ等のアルカリの水溶液を用いる10こともできる。脱脂処理に苛性ソーダ等のアルカリの水溶液を用いた場合、上記脱脂処理のみでは除去できない汚れや酸化皮膜も除去することができる。

【0022】感光層との密着性を良好にし、かつ保水性を改善するために行われる砂目立て処理の方法としては、例えば機械的粗面化方法、電気化学的粗面化方法が挙げられる。

【0023】機械的方法としては、例えばボール研磨 法、ブラシ研磨法、ブラスト研磨法、液体ホーニングに よる研磨法、バフ研磨法等が挙げられる。アルミニウム 20 材の組成等に応じて上述の各種方法を単独或いは組合わ せて用いることができる。又電気化学的粗面化方法は、 塩酸、硝酸等を含む電解液中で交流或いは直流により支 持体を電解処理する方法等がある。このうち何れか1 つ、もしくは2つ以上の方法を併用することにより、支 持体を砂目立てすることができる。詳しくは、例えば塩 酸、硝酸等及びその混合液、更にこれらに硝酸アルミニ ウム、塩化アルミニウム、硝酸アンモニウム、塩化アン モニウム、硝酸マンガン、塩化マンガン、硝酸鉄、塩化 鉄等の塩類を添加してもよく、又塩化ナトリウムや硝酸 30 ナトリウム等の中性塩水溶液を電解液として電解処理す る方法等がある。硝酸主体の電解液は、硝酸を2~40 g/l含有する水溶液であり、硝酸のアルミニウムに塩 を含んでも良い。又無機酸、カルボン酸、アミン、ケト ン、アルデヒド或いはこれらの複合構造を有する化合物 などの添加剤を電解液に添加しても良い。本発明におい ては、機械的粗面化によりマクロ形状の砂目を形成した アルミニウム表面を化学的に処理し、引き続き電気化学 的粗面化によりミクロ形状の砂目を形成することによっ て安定な条件で平均粗さ (Rz) が大きくて均一な砂目 40 を有し、しかも使用電力や電気化学的粗面化の際に生じ るアルミニウムイオンの量を減少させることができる。 しかし上記のように機械的に砂目立てされたアルミニウ ム板の表面には砂目立ての際に食い込んだ研磨剤、アル ミニウム屑等がそのまま存在し、引き続き電気化学的粗 面化を行うと、粗面化が不均一となり、又そのアルミニ ウム板の表面に多くの不溶解残渣を発生させることにな る。そのため電気化学的に砂目立てされたアルミニウム 板の平滑化、均一化を目的としてアルミニウム板の表面 に酸又はアルカリの水溶液による化学的処理を行うこと 50

が必要である。上記酸又はアルカリ水溶液の具体例としては、例えば弗酸、弗化ジルコン酸、リン酸、硫酸、塩酸、硝酸等の酸及び水酸化ナトリウム、珪酸ナトリウム、炭酸ナトリウム等のアルカリ水酸液が挙げられる。これらの酸又はアルカリ水溶液はそれぞれ一種又は二種以上を混合して使用することができる。化学的処理はこれらの酸又はアルカリの0.05~40重量%水溶液を用い、40~100℃の液温において5~300秒処理するのが一般的である。このようにして得られた支持体表面には、スマットが生成しているのでこのスマットを除去するために適宜水洗或いはアルカリエッチング等の

処理を行うことが一般的に好ましい。このような処理と

しては特公昭48-28123号に記載されているアル

カリエッチング法や特開昭53-12739号に記載さ

れているデスマット法等の処理方法が挙げられる。

【0024】電解粗面化において印加される電圧は1~50ボルトが好ましく、2~30ボルトが更に好ましい。電流密度は10~150A/dm²が好ましく、20~100A/dm²が更に好ましい。電気量は100~2000c/dm²、好ましくは100~10000c/dm²、より好ましくは200~5000c/dm²である。温度は10~50℃が好ましく、15~45℃が更に好ましい。塩酸又は硝酸濃度は、0.01~5重量%が好ましい。

【0025】(熊様1)表面の保水性や耐摩耗性を高め るために陽極酸化処理が施される。アルミニウム板の陽 極酸化処理に用いられる電解質としては多孔質酸化皮膜 を形成するものならばいかなるものでも使用することが でき、一般には硫酸、クロム酸、シュウ酸、リン酸、マ ロン酸等を1種又は2種以上含む溶液が用いられる。そ れらの電解質の濃度は電解質の種類により適宜決められ る。陽極酸化の処理条件は用いる電解質により種々変わ るので一概に特定し得ないが、一般的には電解質の濃度 が1~80重量%の溶液、液温は1~70℃、電流密度 1~60A/dm²、電圧1~100V、電解時間10 秒~5分の範囲にあれば適当である。特に好ましい硫酸 法は通常直流で処理が行われるが、交流を用いることも 可能である。硫酸の濃度は5~30%で使用され、20 ~60℃の温度範囲で5~250秒間電解処理される。 この電解液には、アルミニウムイオンが含まれている方 が好ましい。

【0026】更にこのときの電流密度は $1\sim20$ A/d m^2 が好ましい。その他、米国特許第1、412、768 号に記載されている硫酸中で高電流密度で電解する方法や、米国特許第3、511、661 号に記載されているリン酸を用いて電解する方法がある。本発明の態様 2では、形成された陽極酸化皮膜量は $10\sim60$ mg/d m^2 を有するものであるが、好ましくは $10\sim50$ mg/d m^2 を有するものであるが、好ましくは $10\sim50$ mg/d m^2 、特に好ましくは $20\sim50$ mg/d m^2 である。該皮膜量が10 mg/d m^2 未満であると露光の際

のレーザーの画像書き込み効率が非常に悪く、本発明の 効果を容易に奏し難く、又逆に60mg/dm²を越え ると断熱効果は高いが印刷時に汚れやすくなり、画像形 成に支障を来す。陽極酸化皮膜量は、例えばアルミニウ ム板をリン酸クロム酸浴液(リン酸85%液:35m 1、酸化クロム(IV):20gを11の水に溶解して作 製) に浸漬し、酸化皮膜を溶解し、板の皮膜溶解前後の 重量変化測定から求められる。

【0027】封孔処理は、沸騰水処理、水蒸気処理、ケ イ酸ソーダ処理、重クロム酸塩水溶液処理等が具体例と 10 して挙げられる。この他にアルミニウム板支持体に対し て、水溶性高分子化合物や、フッ化ジルコン酸等の金属 塩の水溶液による下引き処理を施すこともできる。

【0028】支持体には、特に限定はされないが水洗処 理等を施しても良い。特に好ましくは支持体を80~9 5℃程度の熱水又はアルカリ水溶液中に浸漬処理するこ とが挙げられる。次いで亜硝酸塩溶液で処理され、陽極 酸化層が封孔される。亜硝酸塩の例としては、周期律表 のΙa, IIa, IIb, IIIb, IVa, IVb, VIa, VIIa, VIII族の亜硝酸塩又はアンモニウム塩、即ち亜硝酸アン 20 モニウムが挙げられ、その金属塩としては例えば、Li O₂, NaNO₂, KNO₂, Mg (NO₂)₂, Ca (N O_2) 2, Z_n (NO_2) 2, A_1 (NO_2) 3, Z_r (NO2) 4, Sn (NO₂) 3, Cr (NO₂) 3, Co (N O₂)₂, Mn (NO₂)₂, Ni (NO₂)₂等が好まし く、特にアルカリ金属亜硝酸塩が好ましい。亜硝酸塩は 2種以上併用することもできる。 亜硝酸塩処理方法とし ては水溶液に浸漬する方法又は水溶液を支持体に塗布す る方法が挙げられるが、水溶液に浸漬する方法がより好 ましい。処理条件は、支持体の状態及びアルカリ金属の 30 種類により異なるので一義的には決定できないが、例え ば、亜硝酸ナトリウムを用いた場合には、濃度は一般的 には0.001~10重量%、より好ましくは0.01 ~2重量%、浴温度は一般的には室温から約100℃前 後、より好ましくは10~180秒のそれぞれの範囲か ら選択すれば良い。亜硝酸水溶液のpHは8.0~1 1. 0に調整されていることが好ましく、8. 5~9. 5に調整されていることが特に好ましい。 亜硝酸水溶液 のpHを上記の如く調整するには例えば、アルカリ緩衝 液等を用いる方法が挙げられる。アルカリ緩衝液として 40 は限定されないが、例えば炭酸水素ナトリウム、水酸化 ナトリウムの混合溶液、炭酸ナトリウムと水酸化ナトリ ウムの混合溶液、炭酸ナトリウムと炭酸水素ナトリウム の混合溶液、塩化ナトリウムと水酸化ナトリウムの混合 溶液、塩酸と炭酸ナトリウムの混合溶液、四ホウ酸ナト リウムと水酸化ナトリウムの混合溶液等を好適に用いる ことができる。又上記アルカリ緩衝液はナトリウム以外 のアルカリ金属塩、例えばカリウム塩等も用いることが できる。該亜硝酸塩処理の効果を高めるために、該処理 液中に超音波をかけてもよい。又必要に応じて添加剤を 50 ホン酸、1-アミノエタン-1,1-ジホスホン酸、1

加えることもでき、例えば、界面活性剤である。

【0029】 (態様2) 本発明の第2の態様として挙げ た金属支持体表面に断熱層を設けたタイプについて説明 する。断熱層は、金属支持体表面に直接設けても或いは 陽極酸化皮膜を設けた金属支持体表面に設けてもよい。 【0030】断熱層、即ち断熱性下塗層は耐熱性かつ水 溶性(親水性)の樹脂(高分子)を有することが好まし く、特に後述する現像液に可溶なものが更に好ましい。 具体的には、ポリアクリル酸、ポリアクリルアミド、ポ リビニルアルコール、ポリヒドロキシエチルアクリレー ト、ポリビニルピロリドン等のアクリル酸共重合体;ポ リエチレンイミン、ジアクリルジメチルアルミニウムク ロライド、ポリビニルイミダゾリン、ポリアルキルアミ ノエチルアクリレート等のマレイン共重合体; 又ポリエ チレングリコールポリオキシエチレン、ポイプロピレン グリコール、エチレンジアミン、ヘキサエチレンジアミ ン、ポリウレタン樹脂、ポリヒドロキシメチル尿素、ポ リヒドロキシメチルメラミン樹脂、更に可溶性デンプ ン、CMC(カルボキシメチルセルロース)、ヒドロキ シエチルセルロース、グアーガム、トラガカントゴム、 キサンタンガム、アルギン酸ソーダ、ゼラチン等の水溶 性高分子が挙げられる。

【0031】これらは水溶液として支持体に塗布し断熱 層を形成するが、上記水溶性高分子を10重量%以下、 好ましくは0.001~1重量%を含有するのがよく、 又pH値9以下、好ましくは4~9であり、温度30℃ 以上、好ましくは50~95℃の条件下で上記の条件を 備えていることがよい。

【0032】本発明における断熱層を形成する構成成分 として、更に特開昭60-149491号、同63-1 65183号に記載のアミノ酸及びその塩、特開昭60 -232998号に記載の水酸基を有するアミン類及び その塩、特開昭62-19494号に記載のリン酸塩、 特開昭59-101651号に記載のスルホ基を有する モノマー単位を含む高分子化合物等を挙げることができ る。又、金属支持体がアルミニウム板である場合、陽極 酸化処理後に米国特許第3,181,461号に記載さ れているアルカリ金属シリケートで処理を行い、断熱層 とすることも可能である。又断熱層の別の形態として、 陽極酸化処理後に1つ以上のアミノ基と、カルボキシル 基、スルホ基及びホスホン基から選ばれた1つ以上の基 を有する化合物又はその塩を用いて支持体表面を処理す ることもでき、該化合物の具体例としては、グリシン、 アラニン、バリン、セリン、スレオニン、アスパラギン 酸、グルタミン酸、アルキニン、リジン、トリプトファ ン、パラヒドロキシフェニルグリシン、ジヒドロキシエ チルグリシン、アントラニル酸等のアミノ酸:1-アミ ノメチルホスホン酸、2-アミノメチルホスホン酸、2 ーアミノプロピルホスホン酸、4ーアミノフェニルホス

ーアミノー1ーフェニルメタンー1, 1ージホスホン 酸、1-ジメチルアミノブタン-1、1-ジホスホン 酸、エチレンジアミンテトラメチレンホスホン酸等のホ スホン酸或いはホスホン酸基をホスフィン酸基に変えた ホスフィン酸等の化合物又は塩酸、硫酸、硝酸、スルホ ン酸(メタンスルホン酸等)、蟻酸、アルカリ金属、ア

ンモニア、低級アルカノールアミン(トリエタノールア ミン等)、低級アルキルアミン(トリエチルアミン)等 の塩が挙げられる。 【0033】本発明においては、上記金属支持体の表面 10

の中心線平均粗さ(Ra)が0.3以上0.7μm以下 であり、又平均粗さ(R z)が3. 0以上6. 0μm以 下であることが好ましい。Raが0.3μm未満では断 熱層及び感光層との密着不良を起こし、又 0. 7 μ m を 越えると逆に密着性は改善するものの、表面エネルギー γが低下する傾向にある。又、R z が 3. 0 μ m未満で は表面エネルギーyは向上するが、密着性が不十分であ り、6. 0μmを越えると表面エネルギーγが低下し、 非画線部の汚れが目立ち画像形成し支障を来す。

【0034】又、上記金属支持体の感光層を除去した際 20 の支持体の表面エネルギーy (H:水素結合力)が、下 記式で15以上50 dyn/cm以下であることが好ま しい。

 $[0035] \gamma (H) dyn/cm = [(1.159+$ 2. 159×cos (接触角: H₂O) -cos (接触 角:CH2 I2)] / 0. 3792

(接触角はH₂O: 1. 7 μ l、CH₂I₂: 1. 3 μ l を滴下し30秒後に測定)

本発明に用いられる金属支持体 (特にアルミニウム板) は、画像形成の際その表面が水を受容して油性インキを 30 反撥する領域(非画線部)を担うように使用されるた め、親水性、保水性が優れていること、又感光層との接 着性が優れているという相反する性能が要求される。非 画線部の保水性が高いと調子再現性、シャドー部の汚れ 難さ等の印刷性能が向上するといわれ、従来も関連の有 る物性値の測定が行われているが、非画線部を水で濡ら し、続いて乾燥させる際のばらつきが大きく、十分な測 定制度が得られないという問題があった。特開平6-2 47070号ではシリコンゴムローラーで水を絞る操作 を行っているが、絞る速度、ローラー、測定箇所による 40 変動が大きく、十分な再現性が得られなかった。そこで 再現性良く水を保持させる方法について検討した結果、 金属支持体を水に浸漬後、水面に垂直にして2 c m/m inの一定速度で引き上げることにより、金属支持体表 面の水の保持量を制度よく測定できることを見出した。 更に現像後の種々の金属支持体非画線部について、低速 引き上げによる水の保持量と表面エネルギーγ(H)と を測定し、印刷性能との比較を行った結果、金属支持体 非画線部の水の保持量が2.0~6.0m1/m²、上

10

0 dyn/cm以下の範囲であると、調子再現件、特に ドットゲインに優れ、又保持量が3.0~5.0ml/ m²の範囲で特に優れていることを見出した。水の保持 量がこれより低いと調子再現性が劣るとともに非画線部 の汚れが発生しやすくなる。又この範囲よりも高いと、 一旦インキが付着した後の回復性、いわゆる汚れ回復等 の印刷性能が劣る。又表面エネルギーy (H) が50 d y n/c mより高いと調子再現性が劣る傾向にある。以 上のように、本発明の好ましい態様は、金属支持体非画 線部の湿し水の保持量、とりわけ親水性(表面エネルギ ーy)を制御することであり、それにより調子再現性、 特にドットゲインが改善されるという効果を奏する。

【0036】〈感光層〉

(活性光線の照射により酸を発生し得る化合物) 本発明 に用いられる活性光線の照射により酸を発生し得る化合 物(以下「光酸発生剤」という)としては、各種の公知 化合物及び混合物が挙げられる。例えばジアゾニウム、 ホスホニウム、スルホニウム、及びヨードニウムのBF 4⁻、PF₆⁻、SbF₆⁻、SiF₆²⁻、ClO₄⁻などの 塩、有機ハロゲン化合物、オルトキノンージアジドスル ホニルクロリド、及び有機金属/有機ハロゲン化合物も 活性光線の照射の際に酸を形成又は分離する活性光線感 光性成分であり、本発明における光酸発生剤として使用 することができる。原理的には遊離基形成性の光開始剤 として知られるすべての有機ハロゲン化合物はハロゲン 化水素酸を形成する化合物であり、本発明における光酸 発生剤として使用することができる。

【0037】前記のハロゲン化水素酸を形成する化合物 の例としては米国特許第3,515,552号、同第 3,536,489号及び同第3,779,778号及 び西ドイツ国特許公開公報第2,243,621号に記 載されているものが挙げられ、又例えば西ドイツ国特許 公開公報第2,610,842号に記載の光分解により 酸を発生させる化合物も使用することができる。又、特 開昭50-36209号に記載されている。一ナフトキ ノンジアジドー4ースルホン酸ハロゲニドを用いること ができる。

【0038】本発明において、赤外線露光による画像形 成過程での感度、及び画像形成材料として用いた際の保 存性等の面から有機ハロゲン化合物が好ましい。該有機 ハロゲン化合物としては、ハロゲン置換アルキル基を有 するトリアジン類及びハロゲン置換アルキル基を有する オキサジアゾール類が好ましく、ハロゲン置換アルキル 基を有するs-トリアジン類が特に好ましい。ハロゲン 置換アルキル基を有するオキサジアゾール類の具体例と しては、特開昭54-74728号、特開昭55-24 113号、特開昭55-77742号、特開昭60-3 626号及び特開昭60-138539号に記載の2-ハロメチルー1、3、4ーオキサジアゾール系化合物が 記の式で得られた表面エネルギーγ(H)が15以上5 50 挙げられる。2-ハロメチル-1.3.4-オキサジア

11

ゾール系光酸発生剤の好ましい化合物例を下記に挙げ*【0039】る。*

20

【0040】上記ハロゲン置換アルキル基を有するsートリアジン類としては、下記一般式(1)で表される化合物が好ましい。

[0041]

【化2】

【0042】一般式(1)において、Rはアルキル基、ハロゲン置換アルキル基、アルコキシ基で置換されていてもよいフェニルビニレン基又はアリール基(例えばフ 30ェニル基、ナフチル基等)若しくはその置換体を表し、X。はハロゲン原子を表す。一般式(1)で表されるsートリアジン系光酸発生剤の化合物例を次に示す。

[0043]

【化3】

20

30

14

$$CH_3O \longrightarrow CH = CH \longrightarrow N \longrightarrow CCI_3$$

$$CCI_3$$

(2)
$$CH_3O$$
 $CH=CH$ N CCI_3 CCI_3 CCI_3

(9)
$$N \longrightarrow CCI_3$$
 $N \longrightarrow CCI_3$

$$CH_3O \longrightarrow CH = CH \longrightarrow N \longrightarrow CCI_3$$

$$CH_3O \longrightarrow CH = CH \longrightarrow N \longrightarrow CCI_3$$

(4)
$$CH_3O \longrightarrow CH = CH \longrightarrow N \longrightarrow N \longrightarrow CCI_3$$

$$CH_3O \longrightarrow CH_3 \longrightarrow CCI_3$$

(11)
$$CI \longrightarrow N \longrightarrow N \longrightarrow CCI_3$$

(5)
$$CH = CH - N - N - N - CCI_3$$

$$OCH_3 - CCI_3$$

(6)
$$C^{4}H^{9}O \longrightarrow CH = CH \longrightarrow N \longrightarrow CCI^{3}$$

(7)
$$C_5H_{11}O \longrightarrow CH = CH \longrightarrow N \longrightarrow CCI_3$$

[0044] 【化4】

【0045】本発明において光酸発生剤の含有量は、そ 40 の化学的性質及び感光層或いは感光層に含まれる化合物 の物性によって広範囲に変えることができるが、感光層 の固形分の全重量に対して約0.1~約20重量%の範 囲が適当であり、好ましくは0.2~10重量%の範囲 である。

【0046】 (酸により分解し得る結合部を有する化合 物) 本発明に用いられる酸により分解し得る結合部を有 する化合物(以下「酸分解化合物」という)としては、 具体的には、特開昭48-89003号、同51-12 50 0714号、同53-133429号、同55-129

95号、同55-126236号、同56-17345 号に記載されているC-O-C結合を有する化合物、特 開昭60-37549号、同60-121446号に記 載されているSi-〇-C結合を有する化合物、特開昭 60-3625号、同60-10247号各公報に記載 されているその他の酸分解化合物が挙げられ、更に特願 昭61-16687号に記載されているSi-N結合を 有する化合物、特願昭61-94603号に記載されて いる炭酸エステル、特願昭60-251744号に記載 されているオルト炭酸エステル、特願昭61-1254 73号に記載されているオルトチタン酸エステル、特願 昭61-125474号に記載されているオルトケイ酸 エステル、特願昭61-155481号に記載されてい るアセタール及びケタール、特願昭61-87769号 に記載されているC-S結合を有する化合物などが挙げ られる。

【0047】上記のうち前記特開昭53-133429 号、同56-17345号、同60-121446号、 同60-37549号及び特願昭60-251744 号、同61-155481号に記載されているC-O- 20 C結合を有する化合物、Si-O-C結合を有する化合 物、オルト炭酸エステル、アセタール類、ケタール類及 びシリルエーテル類が好ましい。それらの中でも特開昭 53-133429号に記載された主鎖中に繰り返しア セタール又はケタール部分を有し、現像液中でのその溶 解度が酸の作用によって上昇する有機重合化合物及び特 開昭63-10153号に記載の下記構造単位

[0048]

【化5】

(ここで、Xは -c 又は -H を表し、

Yは 一C を表す。更にX及びYはそれぞれ

同一でも異なっていてもよい。)

【0054】式中、R、R1及びR2は各々水素原子、炭 素原子数1~5のアルキル基、炭素原子数1~5のアル コキシ基、スルホ基、カルボキシル基又はヒドロキシル 基を表し、p、q及びrは各々1~3の整数を表し、m 50 基、tertーブチル基、ペンチル基等が挙げられ、ア

【0050】本発明に用いられる酸分解化合物の具体例 としては前記各公知例に記載された化合物を挙げること

16

*【0049】を有し、酸により分解し得る化合物が特に

ができる。又、該化合物の合成方法も前記各公知例に記 載されている。

【0051】本発明において、酸分解化合物として、-(CH₂CH₂O)_n-基(nは2~5の整数を表す)を 有する化合物が感度及び現像性のバランスの点から好ま 10 しい。又、該化合物のうちエチレンオキシ基の連鎖数n が3又は4の化合物が特に好ましい。上記-(CH2C H₂O)_n-基を有する化合物の具体例としてはジメトキ シシクロヘキサン、ベンズアルデヒド及びそれらの置換 誘導体と、ジエチレングリコール、トリエチレングリコ ール、テトラエチレングリコール及びペンタエチレング リコールの何れかとの縮合生成物が挙げられる。

【0052】又、本発明において、酸分解化合物とし て、下記一般式(2)で表される化合物が感度及び現像 性の点から好ましい。

[0053]

【化6】

及びnは各々1~5の整数を表す。R、Rュ及びR₂が表 すアルキル基は直鎖でも分岐でもよく、例えばメチル 基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、ブチル

ルコキシ基としては例えばメトキシ基、エトキシ基、プ ロポキシ基、イソプロポキシ基、ブトキシ基、tert ーブトキシ基、ペントキシ基等が挙げられ、スルホ基及 びカルボキシル基はその塩を包含する。一般式 (2) で 表される化合物のうち、m及びnが1又は2である化合 物が特に好ましい。一般式 (2) で表される化合物は公 知の方法で合成することができる。

【0055】本発明において、酸分解化合物の含有量 は、感光層を形成する組成物の全固形分に対し、5~7 0 重量%が好ましく、特に好ましくは 1 0~5 0 重量% 10 である。酸分解化合物は1種を用いてもよいし、2種以 上を混合して用いてもよい。

【0056】(酸により架橋する基を有する化合物)本 発明において、酸により架橋する基を有する化合物とし ては、酸の存在下でアルカリ可溶性樹脂と架橋し得る化 合物(以下、架橋剤という)、即ち架橋しアルカリに対 する溶解性を低減させ得る架橋剤である。アルカリに対 する溶解性を低減させ得る程度としては、アルカリ可溶 性樹脂と架橋することによって該樹脂が全くのアルカリ 形成材料として用いた際、露光により前記架橋剤の作用 で本来アルカリ可溶性であったものが現像剤として用い るアルカリ溶液に対して不溶性を示し、支持体上に残存 している状態を表す。前記架橋剤としては、メチロール 基又はメチロール基の誘導体、メラミン樹脂、フラン樹 脂、イソシアネート、ブロックド-イソシアネート(保 護基を有すイソシアネート)などが挙げられるが、メチ ロール基又はアセチル化メチロール基を有している架橋* *剤が望ましい。感光層固形分に対する添加量は1~80 重量%、好ましくは5~60重量%である。

【0057】(赤外線吸収剤)本発明に用いられる赤外 線吸収剤としては、波長700mm以上に吸収を持つ赤 外吸収色素、カーボンブラック、磁性粉等を使用するこ とができる。特に好ましい赤外線吸収剤は700~85 Ο n m に吸収ピークを有し、ピークでのモル吸光係数 ε が105以上の赤外吸収色素である。

【0058】上記赤外吸収色素としては、シアニン系色 素、スクアリウム系色素、クロコニウム系色素、アズレ ニウム系色素、フタロシアニン系色素、ナフタロシアニ ン系色素、ポリメチン系色素、ナフトキノン系色素、チ オピリリウム系色素、ジチオール金属錯体系色素、アン トラキノン系色素、インドアニリン金属錯体系色素、分 子間CT色素等が挙げられる。上記赤外吸収色素として は、特開昭63-139191号、同64-33547 号、特開平1-160683号、同1-280750 号、同1-293342号、同2-2074号、同3-26593号、同3-30991号、同3-34891 不溶性を示す物性に変化すればよく、具体的には、画像 20 号、同3-36093号、同3-36094号、同3-36095号、同3-42281号、同3-10347 6 号等に記載の化合物が挙げられる。

> 【0059】本発明において、赤外線吸収剤として、下 記一般式(3)又は(4)で表されるシアニン系色素が 特に好ましい。

[0060]

【化7】

一般式(3)

一般式(4)

【0061】式中、Z1及びZ2は各々硫黄原子、セレン 原子又は酸素原子を表し、X1及びX2は各々置換基を有 していてもよいベンゾ縮合環又はナフト縮合環を形成す るのに必要な非金属原子群を表し、R₃及びR₄は各々置 換基を表し、R₃及びR₄のどちらか一方はアニオン性解 離性基を有する。Rs、Rs、R7及びRsは各々炭素原子 数1~3のアルキル基、水素原子又はハロゲン原子を表 す。 L は炭素原子数5~13の共役結合の連鎖を表す。

【0062】一般式(3)又は(4)で表されるシアニ ン系色素は、一般式(3)又は(4)がカチオンを形成 し、対アニオンを有するものを包含する。この場合、対 アニオンとしては、Cl⁻、Br⁻、ClO₄-、BF₄-、 t ーブチルトリフェニルホウ素等のアルキルホウ素等が 挙げられる。

【0063】一般式(3)及び(4)において、Lで表 50 される共役結合の連鎖の炭素原子数(n)は、画像露光

の光源として赤外線を放射するレーザーが使用される場 合、該レーザーの発信波長に合わせて有効な値を選択す ることが好ましい。例えば、発信波長1060mmのY AGレーザーを使用する場合は、nは9~13が好まし い。又、この共役結合部分は任意の置換基を有すること ができ、又共役結合部分は複数の置換基により環を形成 させてもよい。又、X1で表される環及びX2で表される 環には任意の置換基を有することができる。該置換基と してハロゲン原子、炭素原子数1~5のアルキル基、炭 素原子数1~5のアルコキシ基、-SO₃M及び-CO OM(Mは水素原子又はアルカリ金属原子)から選ばれ る基が好ましい。R₃及びR₄は各々任意の置換基である が、好ましくは炭素原子数1~5のアルキル基若しくは 炭素原子数 $1 \sim 5$ のアルコキシ基; - ((CH₂)_n-O -) _k- (CH₂) _mOR (n及びmは各々1~3の整 数、kは0又は1、Rは炭素原子数1~5のアルキル基 を表す。);R₃及びR₄の一方が-R-SO₃Mで他方 が $-R-SO_3$ (Rは炭素原子数1~5のアルキル基、

Mはアルカリ金属原子を表す);又はR₃及びR₄の一方が-R-COOMで他方が $-R-COO^-$ (Rは炭素原子数 $1\sim5$ のアルキル基、Mはアルカリ金属原子を表す。)である。R₃及びR₄は、感度及び現像性の点から、R₃及びR₄の一方が上記 $-R-SO_3$ で以る-R-COOMであることが好ましい。

20

【0064】一般式(3)又は(4)で表されるシアニン系色素は、画像露光の光源として半導体レーザーを使 10 用する場合は $750\sim900$ n m、YAG レーザーを使 用する場合は $900\sim1200$ n mにおいて吸収ピークを示し、 $\epsilon>1\times10^5$ のモル吸光係数を有するものが

【0065】本発明に好ましく用いられる赤外線吸収剤の代表的具体例を以下に挙げるが、これらに限定されるものではない。

[0066]

【化8】

21 **IR1**

IR2

IR3

$$(CH_3)_2N$$
 $CH-CH=CH$
 BF_4
 $(CH_3)_2N$
 $N(CH_3)_2$

IR4

[0067]

【化9】

23

IR5

IR6

$$CH_3$$
 CH CH CH $CH_3)_2$ CIO_4

IR7

IR8

$$\begin{bmatrix} C_1 & S_1 & S_2 & C_1 \\ C_1 & S_2 & S_3 & C_1 \end{bmatrix} \xrightarrow{\mathsf{h}} (C_4 \mathsf{H}_9)_4$$

[0068]

【化10】

25

IR9

IR10

$$Cu^{2+} = \begin{bmatrix} -O & & & & \\ & &$$

IR11

IR12

$$\begin{bmatrix} C_2H_5 & NH_2 \\ C_2H_5 & NH \end{bmatrix}$$

$$(4.1.1)$$

[0069]

27 **IR13**

$$(t)C_{5}H_{11} \xrightarrow{I_{1}} C_{5}H_{11}(t)$$

$$(t)C_{5}H_{11} \xrightarrow{I_{1}} C_{5}H_{11}(t)$$

[0070] 【化12】

IR14

IR15

IR16

IR17

$$\begin{array}{c|c} \text{(H$_5$C$_2$)$_2$N} & & \text{N$_1$(C$_2$H$_5$)$_2} \\ \hline \\ \text{(H$_5$C$_2$)$_2$N} & & \text{N$_1$(C$_2$H$_5$)$_2} \\ \hline \end{array}$$

[0071]

【化13】

31

IR18

IR19
$$C_2H_5-N_+ \longrightarrow CH=CH-CH=CH-CH=N-C_2H_5$$

IR20
$$C_2H_5-N_+ CH=CH - CH=CH$$

$$N-C_2H_5$$

IR21
$$\begin{bmatrix}
S \\
CH=CH \\
S \\
C_2H_5
\end{bmatrix}
CH=CH$$

$$\begin{bmatrix}
S \\
C_2H_5
\end{bmatrix}$$
Br

IR22

[0072]

40 【化14】

IR23

Se
Se
Se
Se
Se

$$\begin{array}{c|c}
Se \\
CH=CH \rightarrow CH \rightarrow N \\
C_2H_5
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
C_2H_5
\end{array}$$

IR24

IR25

IR26

$$H_3C$$
 CH_3
 CH_3
 CH_3C
 H_3C

IR27

$$\begin{bmatrix} & & & \\$$

[0073]

【化15】

35

IR28

IR29

$$\begin{bmatrix} & & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & &$$

IR30

IR31

[0074]

【化16】

37

IR32

$$\begin{array}{c|c} \mathsf{CH_3SO_2} & & \mathsf{CH_3} \\ \mathsf{O} & & \mathsf{NEt_2} \\ & & \mathsf{CH_3} \end{array}$$

IR33

IR34

IR35

$$\begin{array}{c|c} & & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ &$$

[0075]

【化17】

IR37

IR38

[0076]

【化18】

41 IR39

IR40

IR41

[0077]

【化19】

43

IR42

IR43

IR44

IR45

[0078]

【化20】

45

IR46

IR47

IR48

IR49

IR50

$$CH_3$$
 CH_3 CH_3 CH_3 CH_3 CH_3 CH_4 CH_5 CH_5

[0079]

【化21】

IR51

$$C_2H_5$$

$$C_2H_5$$

$$C_2H_5$$

$$C_2H_5$$

$$C_2H_5$$

IR52

IR53
$$CI \longrightarrow CH = CH \longrightarrow CH - CH \longrightarrow CI$$

$$C_2H_5 \longrightarrow CIO_4 \longrightarrow$$

IR54

$$CH_3$$
 CH_3 CH_3 CH_3 CH_3 CH_3 CH_4 CH_5 CH_5

IR55

【0080】これらの色素は公知の方法によって合成す ることができるが、下記のような市販品を用いることも できる。

【0081】日本化薬: 【R750 (アントラキノン 系); IROO2, IROO3 (アルミニウム系); I R820 (ポリメチン系); IRG022、 IRG03 3 (ジインモニウム系); CY-2, CY-4, CY-9, CY-20、三井東圧: KIR103, SIR10 3 (フタロシアニン系); KIR101, SIR114 (アントラキノン系); PA1001, PA1005, PA1006, SIR128 (金属錯体系)、大日本イ 50 説明する。例えばnープロパノール、イソプロピルアル

ンキ化学: Fastogen blue8120、みど り化学: MIR-101, 1011, 1021等。その 他、日本感光色素、住友化学、富士写真フイルム等の各 社からも市販されている。

【0082】本発明において、赤外線吸収剤の添加量 は、0.5~10重量%の範囲が好ましい。該添加量が 10重量%を越えると非画像部(露光部)の現像性が低 下し、0.5重量%未満では画像部の耐現像性が低下す る。

【0083】(溶剤)本発明に用いられる溶剤について

コール、nーブタノール、secーブタノール、イソブ タノール、2ーメチルー1ーブタノール、3ーメチルー 1-ブタノール、2-メチル-2-ブタノール、2-エ チルー1ーブタノール、1ーペンタノール、2ーペンタ ノール、3-ペンタノール、n-ヘキサノール、2-ヘ キサノール、シクロヘキサノール、メチルシクロヘキサ ノール、1-ヘプタノール、2-ヘプタノール、3-ヘ プタノール、1ーオクタノール、4ーメチルー2ーペン タノール、2-ヘキシルアルコール、ベンジルアルコー ル、エチレングリコール、ジエチレングリコール、トリ 10 エチレングリコール、テトラエチレングリコール、1, 3-プロパンジオール、1,5-ペンタングリコール、 ジメチルトリグリコール、フリフリルアルコール、ヘキ シレングリコール、ヘキシルエーテル、3-メトキシー 1-ブタノール、3-メトキシ-3-メチルブタノー ル、ブチルフェニルエーテル、エチレングリコールモノ アセテート、プロピレングリコールモノメチルエーテル (PGM)、プロピレングリコールモノエチルエーテ ル、プロピレングリコールモノプロピルエーテル、プロ ピレングリコールモノブチルエーテル、プロピレングリ 20 エタノール等が挙げられる。 コールフェニルエーテル、ジプロピレングリコールモノ メチルエーテル、ジプロピレングリコールモノエチルエ ーテル、ジプロピレングリコールモノプロピルエーテ ル、ジプロピレングリコールモノブチルエーテル、トリ プロピレングリコールモノメチルエーテル、メチルカル ビトール、エチルカルビトール、エチルカルビトールア セテート、ブチルカルビトール、トリエチレングリコー ルモノメチルエーテル、トリエチレングリコールモノエ チルエーテル、テトラエチレングリコールジメチルエー テル、ジアセトンアルコール、アセトフェノン、シクロ 30 ヘキサノン、メチルシクロヘキサノン、アセトニルアセ トン、イソホロン、乳酸メチル、乳酸エチル、乳酸ブチ ル、炭酸プロピレン、酢酸フェニル、酢酸-sec-ブ チル、酢酸シクロヘキシル、シュウ酸ジエチル、安息香 酸メチル、安息香酸エチル、γ-ブチルラクトン、3-メトキシー1ーブタノール、4ーメトキシー1ーブタノ ール、3-エトキシー1-ブタノール、3-メトキシー 3-メチル-1-ブタノール、3-メトキシ-3-エチ ルー1ーペンタノール、4ーエトキシー1ーペンタノー ル、5-メトキシ-1-ヘキサノール、3-ヒドロキシ 40 - 2 - ブタノン、4 - ヒドロキシ- 2 - ブタノン、4 -ヒドロキシー2ーペンタノン、5ーヒドロキシー2ーペ ンタノン、4ーヒドロキシー3ーペンタノン、6ーヒド ロキシー2ーペンタノン、4ーヒドロキシー3ーペンタ ノン、6-ヒドロキシー2-ヘキサノン、3-メチルー 3-ヒドロキシー2-ペンタノン、メチルセルソルブ (MC)、エチルセルソルブ(EC)等が挙げられる。 又アリルアルコール、イソプロピルエーテル、ブチルエ ーテル、アニソール、プロピレングリコールモノメチル エーテルアセテート、ジエチルカルビトール、テトラヒ 50

ドロフラン、ジオキサン、ジオキソラン、アセトン、メ チルプロピルケトン、メチルエチルケトン、メチルアミ ルケトン、ジエチルケトン、エチルブチルケトン、ジプ ロピルケトン、ジイソブチルケトン、3-ヒドロキシー 2-ブタノン、4-ヒドロキシ-2-ブタノン、酢酸-2-メトキシエチル、酢酸-2-エトキシエチル、酢酸 メトキシブチル、プロピオン酸メチル、プロピオン酸エ

50

チル、プロピオン酸プロピル、酪酸メチル、酪酸エチ ル、酪酸ブチル、N-メチル-2-ピロリドン、アセト ニトリル、ジメチルホルムアミド(DMF)、ジメチル アセトアミド (DMAc)、n-ペンタン、2-メチル ペンタン、3-エチルペンタン、メチルシクロペンタ ン、n-ヘキサン、イソヘキサン、シクロヘキサン、メ チルシクロヘキサン、n-ヘプタン、シクロヘプタン、 nーオクタン、イソオクタン、ノナン、デカン、ベンゼ ン、トルエン、oーキシレン、mーキシレン、pーキシ レン、エチルベンゼン、o-ジエチルベンゼン、m-ジ エチルベンゼン、pージエチルベンゼン、クメン、nー アミルベンゼン、ジメチルジグリコール(DMDG)、

【0084】(結合剤)結合剤に使用する高分子重合体 としては、例えば、ポリアミド、ポリエステル、ポリカ ーボネート、ポリスチレン、ポリウレタン、ポリビニル クロライド、及びそのコポリマー、ポリビニルブチラー ル樹脂、ポリビニルホルマール樹脂、シェラック、エポ キシ樹脂、フェノール樹脂、アクリル樹脂等が挙げられ

【0085】上記フェノール樹脂としては、ノボラック 樹脂が挙げられ、例えばフェノール・ホルムアルデヒド 樹脂、クレゾール・ホルムアルデヒド樹脂、特開昭55 -57841号に記載されているようなフェノール・ク レゾール・ホルムアルデヒド共重縮合体樹脂、特開昭5 5-127553号に記載されているような、p-置換 フェノールとフェノールもしくは、クレゾールとホルム アルデヒドとの共重縮合体樹脂等が挙げられる。

【0086】又上記アクリル樹脂としては、下記(1) ~(17)に記載のモノマーの混合物を共重合して得ら れた共重合高分子重合体が挙げられる。

【0087】上記モノマー混合物には、上記モノマーと 共重合し得る他のモノマーを混合してもよい。又、高分 子重合体は、上記モノマーの共重合体によって得られる 共重合体を例えば、グリシジルアクリレート、グリシジ ルメタクリレート等によって修飾したものであってもよ

【0088】(1) 芳香族水酸基を有するモノマー、例 えば、oーヒドロキシスチレン、pーヒドロキシスチレ ン、m-ヒドロキシスチレン、o-ヒドロキシフェニル アクリレート、pーヒドロキシフェニルアクリレート、 mーヒドロキシフェニルアクリレート等。

【0089】(2)脂肪族水酸基を有するモノマー、例

えば、2ーヒドロキシエチルアクリレート、2ーヒドロキシエチルメタクリレート、Nーメチロールアクリルアミド、Nーメチロールメタクリルアミド、4ーヒドロキシブチルメタクリレート、5ーヒドロキシペンチルアクリレート、5ーヒドロキシペンチルメタクリレート、6ーヒドロキシへキシルメタクリレート、Nー(2ーヒドロキシエチル)アクリルアミド、Nー(2ーヒドロキシエチル)メタクリルアミド、ヒドロキシエチルビニルエーテル等。

【0090】(3) アミノスルホニル基を有するモノマ 10 等。
一、例えば、mーアミノスルホニルフェニルメタクリレ
ート、pーアミノスルホニルフェニルメタクリレート、
mーアミノスルホニルフェニルアクリレート、pーアミ
ノフェニルアクリレート、Nー(pーアミノスルホニル
フェニル)メタクリルアミド、Nー(pーアアミノスル
ホニルフェニル)アクリルアミド等。

【0091】 (4) スルホンアミド基を有するモノマー、例えば、N-(p-h)ルエンスルホニル) アクリルアミド、N-(p-h)ルエンスルホニル) メタクリルアミド等。

【0092】(5) α、β-不飽和カルボン酸類、例えば、アクリル酸、メタクリル酸、マレイン酸、無水マレイン酸、イタコン酸、無水イタコン酸等。

【0093】(6)置換又は無置換のアルキルアクリレート、例えば、アクリル酸メチル、アクリル酸エチル、アクリル酸プロピル、アクリル酸ブチル、アクリル酸アミル、アクリル酸へキシル、アクリル酸へプチル、アクリル酸オクチル、アクリル酸ノニル、アクリル酸デシル、アクリル酸ウンデシル、アクリル酸ドデシル、アクリル酸ベンジル、アクリル酸シクロヘキシル、アクリル 30酸-2-クロロエチル、N、N-ジメチルアミノエチルアクリレート、グリシジルアクリレート等。

【0094】(7) 置換又は無置換のアルキルメタクリレート、例えば、メタクリル酸メチル、メタクリル酸エチル、メタクリル酸プロピル、メタクリル酸ブチル、メタクリル酸でミル、メタクリル酸へキシル、メタクリル酸へプチル、メタクリル酸オクチル、メタクリル酸ノニル、メタクリルデシル、メタクリル酸ウンデシル、メタクリル酸ウンデシル、メタクリル酸ウンデシル、メタクリル酸ベンジル、メタクリル酸シクロヘキシル、メタクリル酸ー2ークロロエチル、N、Nージメチルアミノエチルメタクリレート、グリシジルメタクリレート等。

ドロキシフェニル) メタクリルアミド等。

【0096】(9)フッ化アルキル基を含有するモノマー、例えば、トリフルオロエチルアクリレート、トリフルオロエチルメタクリレート、テトラフルオロプロピルメタクリレート、オクタフルオロペンチルアクリレート、オクタフルオロペンチルメタクリレート、ヘプタデカフルオロデシルメタクリレート、NーブチルーNー(2ーアクリロキシエチル)ヘプタデカフルオロオクチルスルホンアミド等。

【0097】(10) ビニルエーテル類、例えば、エチルビニルエーテル、2-クロロエチルビニルエーテル、プロピルビニルエーテル、ブチルビニルエーテル、オクチルビニルエーテル、フェニルビニルエーテル類。

【0098】(11) ビニルエステル類、例えば、ビニルアセテート、ビニルクロロアセテート、ビニルブチレート、安息香酸ビニル等。

【0099】(12) スチレン類、例えば、スチレン、メチルスチレン、クロロメチルスチレン等。

20 【0100】(13) ビニルケトン類、例えば、メチル ビニルケトン、エチルビニルケトン、プロピルビニルケ トン、フェニルビニルケトン等。

【0101】(14) オレフィン類、例えば、エチレン、プロピレン、イソブチレン、ブタジエン、イソプレン等。

【0102】 (15) N-ビニルピロリドン、N-ビニルカルバゾール、4-ビニルピリジン等。

【0103】(16)シアノ基を有するモノマー、例えばアクリロニトリル、メタクリロニトリル、2ーペンテンニトリル、2ーメチルー3ーブテンニトリル、2ーシアノエチルアクリレート、oーシアノスチレン、mーシアノスチレン、pーシアノスチレン等。

【0104】(17) アミノ基を有するモノマー、例えばN, Nージエチルアミノエチルメタクリレート、N、Nージメチルアミノエチルアクリレート、N, Nージメチルアミノエチルメタクリレート、ポリブタジエンウレタンアクリレート、N, Nージメチルアミノプロピルアクリルアミド、N, Nージメチルアクリルアミド、アクリロイルモルホリン、Nーイソプロピルアクリルアミド、N, Nージエチルアクリルアミド等。

【0105】上記、共重合体は、ゲルパーミエーションクロマトグラフィー(GPC)によって、測定された重量平均分子量が1万~20万のものが好ましいが、当該共重合体の重量平均分子量はこの範囲に限定されるものではない。

【0106】上記高分子重合体には、必要に応じて、ポリビニルブチラール樹脂、ポリウレタン樹脂、ポリアミド樹脂、ポリエステル樹脂、エポキシ樹脂、ノボラック樹脂、天然樹脂等、他の任意の高分子重合体を併用してもよい。

【0107】感光性組成物中における高分子重合体の含有量は、20~90重量%の範囲が好ましく、30~70重量%の範囲が更に好ましい。

【0108】本発明の好ましい態様として、ノボラック樹脂及びアクリル樹脂を含有する態様が挙げられる。該アクリル樹脂はアクリル酸、メタクリル酸、又はそれらのエステル類を構成単位とする重合体が好ましい。ノボラック樹脂は感光層に対して20~80重量%の範囲で含有させることが好ましく、アクリル樹脂は感光層に対して1~50重量%の範囲で含有させることが好ましく、5~30重量%の範囲がより好ましい。

【0109】又本発明の好ましい態様としてノボラック 樹脂及びノニオン界面活性剤を含有する態様が挙げられ る。ノニオン界面活性剤としては、ポリオキシエチレン アルキルエーテル、ポリオキシエチレンアルキルアリル エーテル、ポリオキシエチレン誘導体、オキシエチレン ・オキシプロピレンブロックコポリマー、ソルビタン脂 54

肪酸エステル、ポリオキシエチレンソルビタン脂肪酸エステル、ポリオキシエチレンソルビトール脂肪酸エステル、グリセリン脂肪酸エステル、ポリオキシエチレン脂肪酸エステル、ポリオキシエチレンアルキルアミン、アルキルアルカノールアミド、ポリエチレングリコール等が挙げられる。ノボラック樹脂は感光層固形分に対して20~80重量%の範囲で含有させることが好ましく、ノニオン界面活性剤は感光層固形分に対して0.01~10重量%の範囲で含有させることが好ましく、0.1

【0110】本発明においては、フッ素系界面活性剤を 0.001~5重量%含有させることが経時による非画 像部の汚れ発生防止の点から好ましい。フッ素系界面活 性剤としては例えば次のような化合物が挙げられる。

[0111]

【化22】

C7F15CO2NH4,

C8F17SO2N(C2H5)CH2COOK.

C₈F₁₇SO₂NHC₃H₆N (CH₃)₂Ct ,

C7F15CONH(CH2)3N (CH3)2C2H4COO .

 $C_8F_{17}SO_2N(C_2H_6)C_2H_4(OC_3H_6)_5OH$

 $C_7F_{15}CONHC_3H_6N(CH_3)_2(CH_2)_2COO$

$$C_8F_{17}SO_2N - (CH_2)_3N^{\dagger}(CH_3)_2CH_2COO^{\dagger},$$

 C_3H_7

C8F17SO2NHC3H6N (CH3)2C2H5OS 02OC2H5,

C7F15CONHC3H6N (CH3)3CI ,

$$C_8F_{17}SO_2NHC_3H_6-N+OO^-SO_2C_2H_5$$

$$C_2H_5$$

 $C_8F_{17}SO_2-NCH_2CH_2O(CH_2CH_2O)_{10}H$,
 $C_8F_{17}SO_2N(CH_3)CH_2CH_2O_2CCH=CH_2$,

$$C_8F_{17}SO_2N(CH_3)$$
—--(CH_2 — CH)₁₀H
$$COOC_2H_1$$

【0112】フッ素系界面活性剤としては市販品を用い 40 ファック「F-171」、「F-177」、「F-17ることもでき、例えばサーフロン「S-381」、「S -382], [SC-101], [SC-102], 「SC-103」、「SC-104」(何れも旭硝子 (株) 製)、フロラード「FC-430」、「FC-4 31」、「FC-173」(何れもフロロケミカルー住 友スリーエム製)、エフトップ「EF352」、「EF 301」、「EF303」(何れも新秋田化成(株) 製)、シュベゴーフルアー「8035」、「8036」 (何れもシュベグマン社製)、「BM1000」、「B M1100」(いずれもビーエム・ヒミー社製)、メガ 50 樹脂としては、例えば特開昭50-125806号に記

9」(いずれも大日本インキ化学(株)製)、などを挙 げることができる。

【0113】本発明におけるフッ素系界面活性剤のフッ 素含有割合は、0.05~2%、好ましくは0.1~1 %である。上記のフッ素系界面活性剤は、1種又は2種 以上を併用することができ、又その他の界面活性剤と併 用することができる。

【0114】更に、感光層には、感脂性を向上するため に親油性の樹脂を添加することができる。上記親油性の

58

載されているような、炭素数3~15のアルキル基で置換されたフェノール類とアルデヒドの縮合物、例えばtーブチルフェノールホルムアルデヒド樹脂などが使用可能である。感光層には必要に応じて、更に上記以外の色素、顔料、増感剤、可視画剤等を含有させることができる。

【0115】本発明の画像形成材料は、上述した金属支持体上に、上記の感光性組成物を含有する感光層を有してなることを特徴とする。具体的には、上記の感光性組成物の塗布液を支持体の表面に塗布して感性層を設け、乾燥することで得られる。本発明においては、上記感光層の残留溶剤量が5mg/m²以下であることが好ましく、更に好ましくは3mg/m²以下である。

【0116】本発明の画像形成材料の製造方法は、上述した金属支持体上に上記感光性組成物を設けた後、好ましくは乾燥温度85℃以上、乾燥時間10秒以上の条件で処理を行う。好ましくは乾燥温度90℃以上、乾燥時間30秒以上であり、それらの条件で感光層表面の残留溶剤量が5mg/m²以下となるよう処理することが好ましい。

【0117】塗布方法は従来公知の方法、例えば回転塗布、ワイヤーバー塗布、ディップ塗布、エアーナイフ塗布、ロール塗布、ブレード塗布及びカーテン塗布等が可能である。塗布量は用途により異なるが、例えば、感光性平版印刷版についていえば固形分として0.5~5.0g/m²が好ましい。

【0118】〔2〕画像形成方法

本発明の画像形成材料には波長700nm以上の光源を用い画像露光を行うのが好ましい。光源としては、半導体レーザー、He-Neレーザー、YAGレーザー、炭 30酸ガスレーザー等が挙げられる。出力は50mW以上が適当であり、好ましくは100mW以上である。

【0119】本発明の画像形成材料の現像に用いられる現像液としては、水系アルカリ現像液が好適である。水系アルカリ現像液としては、例えば、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、炭酸ナトリウム、炭酸カリウム、メタケイ酸ナトリウム、メタケイ酸カリウム、第二リン酸ナトリウム、第三リン酸ナトリウム、第三リン酸ナトリウム、第三リン酸ナトリウム等のアルカリ金属塩の水溶液が挙げられる。アルカリ金属塩の濃度は0.05~20重量%の範囲で用いるのが好適であり、より40好ましくは、0.1~10重量%である。

【0120】本発明の画像形成方法において、現像液に*

バインダーA
バインダーB 分子量;38000
酸分解化合物A
酸発生剤(例示(1))
シアニン色素(例示IR-25)
界面活性剤(旭硝子S-381)
溶剤(PGM)

*は、必要に応じアニオン性界面活性剤、両性界面活性剤 やアルコール等の有機溶剤を加えることができる。

【0121】有機溶剤としては、プロピレングリコール、エチレングリコールモノフェニルエーテル、ベンジルアルコール、n-プロピルアルコール等が有用である。

[0122]

【実施例】以下、実施例を挙げて本発明を詳細に説明するが、本発明の態様はこれに限定されない。尚、以下の「部」は「重量部」を表す。

【0123】 実施例1

〈支持体1の作製〉厚さ0.3mmのアルミニウム板 (材質1050、調質H16) を65℃に保たれた5% 水酸化ナトリウム水溶液で1分間脱脂処理を行った後水 洗し、25℃に保たれた10%硫酸水溶液中に1分間浸 積して中和し、更に水洗した。このアルミニウム板を 1. 0重量%の硝酸水溶液中において温度25℃、電流 密度10A/dm2、処理時間60秒の条件で交流電流 により電解粗面化を行なった。次いで、5%水酸化ナト リウム水溶液中で温度60℃、10秒間のデスマット処 理を行ない、その後20%硫酸溶液中で温度20℃、電 流密度3A/dm²、処理時間1分間の条件で陽極酸化 処理を行った。その後、80℃に保たれた1%酢酸アン モニウム水溶液中に30秒間浸積し、水洗後80℃で3 分間乾燥した。更に85℃に保たれたカルボキシメチル セルロース(以下、CMCと略す)の水溶液(濃度0. 1重量%)に30秒浸積して断熱層を設けた後、80℃ で5分間乾燥し支持体を作製した。尚、断熱層の皮膜量 $d0.01 \, \text{mg/m}^2 \text{ cosons}$

【0124】(酸分解化合物Aの合成)1.1ージメトキシシクロヘキサノン(0.5 モル)、2ーフェノキシエタノール(1.0モル)及びpートルエンスルホン酸80mgを混合し、攪拌させながら120℃で8時間反応させた。反応により生成するメタノール及び反応溶剤は、反応終了後除去した。冷却後、水で洗浄し水酸化ナトリウム溶液で洗浄し、その後中性になるまで飽和食塩水で洗浄し、得られた化合物を無水炭酸カリウムで脱水した後濃縮乾固して目的の下記酸分解化合物Aの白色結晶を得た。

【0125】(感光性組成物1の作製)以下に示すような割合で混合し感光性組成物とした。

[0126]

6 O. 7 5 部 1 5 部 2 O部 3 部 1 部 O. 2 5 部 1 O O O部

バインダーA:フェノールとmー、pー混合クレゾール 50 とホルムアルデヒドとの共縮合化合物 Mw=3700

60

 $(7x/-\nu/m-\rho\nu)/(p-\rho\nu)/(p-\rho\nu)/(p-\rho\nu)$ * [0127] 比が5/57/38 * [化23]

酸分解化合物A

バインダーB(組成比: n/m/o/p=36.5/3.5/30/30)

【0128】(画像形成材料の作製)前記作製した支持体上に、上記組成の感光性組成物よりなる感光層塗布液を、乾燥後の膜厚が2.0g/m²になるようにワイヤーバー塗布を行ない95℃で90秒間乾燥して画像形成材料(感光性平版印刷版)を得た。尚、ここでいう感光層を感光層1とする。

【0129】 (画像形成) 得られた感光性平版印刷版を 半導体レーザー (波長 $830\,\mathrm{nm}$ 、出力 $500\,\mathrm{mw}$) で 画像露光を行なった。レーザー光径はピークにおける強 度の $1/\mathrm{e}^2$ で $13\,\mu$ mであった。又、解像度は走査方 向、副走査方向とも $2000\,\mathrm{d}\,\mathrm{p}\,\mathrm{i}$ とした。

【0130】画像露光後、コニカ平版印刷版用現像液S DR-1 (コニカ (株) 製)と水との比が1:5となる よう希釈した。その後30℃に保った現像液に30秒間 浸積して現像を行なった後、水洗、乾燥を行なった。こ の際、非画線部 (露光部)を除去し、ポジ型画像を形成 40 する。 ※

※【0131】〈評価〉

(感度)上記条件において露光部が現像されるのに必要な露光エネルギー (mj/cm^2) で評価した。

【0132】(ドットゲイン)上記感度にて画像形成した平版印刷版で得られたデータを元に、最適露光条件を設定し、別途用意した平版印刷版に最適露光エネルギーで再度画像露光を行い、現像し小点を作成した。印刷機(三菱重工業(株)DAIYA1F-I)、コート紙、湿し水(東京インキ(株)SG-51, 濃度1.5%)、インキ(東洋インキ製造(株)製ハイプラスM紅)を使用し、画像部の濃度を1.6にして印刷を行ったときの印刷物上のスクリーン線数150line/inchの50%網点を測定しゲイン量を測定した。面積の測定はマクベス濃度計を使用した。

【0133】実施例2 以下に示すような割合で混合し感光性組成物とした。 【0134】

(感光性組成物2の作製)

バインダーA50部バインダーB 分子量:3800010部酸架橋型樹脂:レゾール樹脂(昭和高分子社製ショーノールCKP-918)35.75部光酸発生剤(例示(1))3部シアニン色素(例示IR-25)1部界面活性剤(旭硝子S-381)0.25部溶剤(PGM)1000部

(画像形成材料の作製) 前記作製した支持体上に、上記組成の感光性組成物よりなる感光層塗布液を実施例1同様に塗布を行ない、画像形成材料(感光性平版印刷版)を得た。尚、ここでいう感光層を感光層2とする。

【0135】(画像形成)得られた感光性平版印刷版を 半導体レーザー(波長830 n m、出力500 m w)で 画像露光を行なった。その際、レーザー光径はピークに おける強度の $1/e^2$ で 13μ m であった。又、解像度 は走査方向、副走査方向とも2000 d p i とした。画 像露光後、コニカ平版印刷版用現像液SDR-1(コニ 10 す。 カ(株)製)と水との比が1:5となるよう希釈した。 その後30 に保った現像液に30 秒間浸漬して現像を 行なった後、水洗、乾燥を行なった。この際、非画線部*

* (露光部)を除去し、ネガ型画像を形成する。評価は、 実施例1と同様に行った。

【0136】 実施例3~20

実施例1で用いた支持体1を表1及び表2に示すように変更した他は同様にして実施例3~20を行った。尚、実施例1~10は態様1及び2における本発明であり、実施例11~14は態様1における本発明であり、実施例15~20は比較例である。

【0137】得られた結果を以下の表1及び表2に示す

[0138]

【表1】

実施例	感光層	支持体	電解粗面化条件			陽極間	陽極酸化皮膜条件			Ra	Rz
No.			電解液	温度	電流密度	20%処理液	温度	電流密度	陽極酸化 皮膜量		''-
				(°C)	(A/dm ²)		(2)	(A/dm²)	(mg/dm²)	(µm)	(mu)
1	1	1	硝酸	25	10	硫酸	20	3	20	0.65	3.95
2	2		硝酸	25	10	硫酸	20	3	20	0.65	3.95
3	1	2	朝酸	25	10	硫酸	20	3	20	0.65	3.98
4	2		硝酸	25	10	硫酸	20	3	20	0.65	3.95
5	1	3	硝酸	25	10	硫酸	20	3	20	0.65	3.95
6	2		硝酸	25	10	硫酸	20	3	20	0.65	3.95
7	1	4	硝酸	25	6	硫酸	20	3	20	0.34	3.03
8	2		硝酸	25	6	硫酸	20	3	20	0.34	3.03
9	1	5	硝酸	25	3	硫酸	20	5	31	0.28	4.02
10	2		研盤	25	3	硫酸	20	5	31	0.28	4.02
11	1	6	硝酸	25	10	硫酸	20	5	31	0.67	4.02
12	2		硝酸	25	10	硫酸	20	5	31	0.67	4.02
13	1	7	硝酸	25	10	硫酸	20	7	48	0.69	4.02
14	2		硝酸	25	10	磁酸	20	7	48	0.69	4,02
15	1	8	硝酸	25	15	硫酸	20	3	20	0.83	5.18
16	2		硝酸	25	15	硫酸	20	3	20	0.83	5.18
17	1	9	硝酸	25	10	硫酸	20	15	63	0.87	5.18
18	2		硝酸	25	10	硫酸	20	15	63	0.87	5.18
19	1	10	硝酸	25	10	抗酸	20	1	8	0.63	3,25
20	2		硝酸	25	10	流酸	20	1	8	0.63	3.25

[0139]

実施例	断熱層	断熱層	表面エネルギー	レーザー感度	トニットケーイン
No.	素材	皮膜量	γ (H)		変動率
		(mg/m²)	(dyn/cm)	(mJ/cm²)	(%)
1	СМС	0.01	20.3	200	23
2	СМС	0.01	20.3	200	22
3	ポリビニルホスホン酸	0.01	24.7	250	19
4	まずりと、こんまスキン酸	0.01	24.7	200	17
5	CMC	1	43.2	300	24
6	СМС	1	43.2	300	22
7	СМС	0.01	16.1	150	26
8	CMC	0.01	16.1	150	25
9	CMC	0.01	26.8	100	28
10	СМС	0.01	26.8	120	29
11	_	0	45.9	250	30
12		D	45.9	250	28
13		0	51.1	200	26
14		0	51.1	300	24
15		0	36.9	400	47
16		0	36.9	400	42
17		0	39.1	100	45
18	***************************************	0	39.1	100	41
19		0	53.5	>500	20
20		D	53.5	·500	29

【0140】表1及び表2から明らかなように、本発明 により得られたポジ型或いはネガ型の平版印刷版は、赤 外線による露光で画像形成が可能であるのみならず赤外 線に対する感度が高く、かつドットゲインの変動の少な い良好な画像を呈することが分かる。

【0141】実施例21~36 以下のようにして支持体を作製した。

【0142】〈支持体11の作製〉厚さ0.24mmの に保たれた5%水酸化ナトリウム水溶液で1分間脱脂処 理を行った後水洗した。その後、2.25KWモーター からなる研磨ブラシ(材質:ナイロン)3本でストンパ ウダー20%水溶液の研磨剤を使用し、搬送速度6m/ 分でブラシ研磨を行った。次に温度20℃、2.5%塩 酸浴において電流密度20A/dm²、電解時間10秒 間(電気容量として200クーロン)交流電解研磨し、 水洗処理後5%水酸化ナトリウムで50℃、5秒間デス マット処理し、次いで50%硝酸で中和洗浄した。

【0143】 (支持体12の作製) 厚さ0.24mmの 40 アルミニウム板(材質1050、調質H16)を65℃ に保たれた5%水酸化ナトリウム水溶液で1分間脱脂処 理を行った後水洗した。その後、2.25KWモーター からなる研磨ブラシ(材質:ナイロン)3本でストンパ ウダー20%水溶液の研磨剤を使用し、搬送速度6m/ 分でブラシ研磨を行った。次に温度20℃、1. Owt %の硝酸水溶液中において、温度25℃、電流密度10 A/dm²、処理時間60秒の条件で交流電流により電 解粗面化を行なった。次いで、5%水酸化ナトリウム水

った後、50%硝酸で中和洗浄した。

【0144】〈支持体13の作製〉厚さ0.24mmの アルミニウム板(材質1050、調質H16)を65℃ に保たれた5%水酸化ナトリウム水溶液で1分間脱脂処 理を行った後水洗した。その後、2.25KWモーター からなる研磨ブラシ(材質:ナイロン)3本でストンパ ウダー20%水溶液の研磨剤を使用し、搬送速度6m/ 分でブラシ研磨を行った。次に温度20℃、1.0wt アルミニウム板(材質1050、調質H16)を65℃ 30 %の硝酸水溶液中において、温度25℃、電流密度10 A/dm²、処理時間60秒の条件で交流電流により電 解粗面化を行なった。次いで、5%水酸化ナトリウム水 溶液中で温度60℃、10秒間のデスマット処理を行な った。その後、20%硫酸溶液中で温度20℃、電流密 度3A/d m²、処理時間1分間の条件で陽極酸化処理 を行い、水洗、乾燥した。

【0145】〈支持体14の作製〉厚さ0.24mmの アルミニウム板(材質1050、調質H16)を65℃ に保たれた5%水酸化ナトリウム水溶液で1分間脱脂処 理を行った後水洗した。その後、2.25KWモーター からなる研磨ブラシ(材質:ナイロン)3本でストンパ ウダー20%水溶液の研磨剤を使用し、搬送速度6m/ 分でブラシ研磨を行った。次に温度20℃、1.0wt %の硝酸水溶液中において、温度25℃、電流密度10 A/dm²、処理時間60秒の条件で交流電流により電 解粗面化を行なった。次いで、5%水酸化ナトリウム水 溶液中で温度60℃、10秒間のデスマット処理を行な った。その後、20%硫酸溶液中で温度20℃、電流密 度3A/d m²、処理時間1分間の条件で陽極酸化処理 溶液中で温度60℃、10秒間のデスマット処理を行な 50 を行った。85℃に保たれたポリビニルホスホン酸(以

下、PVPAと略す)の水溶液 (濃度 0. 1 w t %) に 3 0 秒浸漬した後、8 0 ℃で 5 分間乾燥した (断熱材: PVPAの付き量 0. 0 1 m g / m²)。

【0146】〈支持体15の作製〉厚さ0.24mmのアルミニウム板(材質1050、調質H16)を研磨ブラシ(材質:ナイロン)と400メッシュのパミストン水懸濁液を用いてアルミ表面をブラシ研磨し、水洗した。10%水酸化ナトリウム水溶液中にて70℃、60秒間でエッチングを行い、水洗後、20%硝酸水溶液で中和洗浄した。これをVa=12.7Vの条件下で正弦 10波の交番波形電流を用いて1%硝酸水溶液中で160C/dm²の条件下で電解粗面化を行った。次いで、30%の硫酸水溶液中に浸漬し、温度55℃、処理時間2分でデスマット処理を行った。その後、20%硫酸水溶液中で電流密度2A/dm²条件下で2分間陽極酸化処理を行った。

【0147】〈支持体16の作製〉厚さ0.24mmのアルミニウム板(材質1050、調質H16)を研磨ブラシ(材質:ナイロン)をトリクロロエチレン洗浄し脱脂後、400メッシュのパミストン水懸濁液を用いてア 20ルミ表面をブラシ研磨し水洗した。このアルミ板を25%水酸化ナトリウム水溶液に45℃で10秒間浸漬して水洗した。次いで7%硫酸電解液、電流密度15A/dm²で直流陽極酸化皮膜を設け、水洗乾燥した。

【0148】 (支持体17の作製) 厚さ0. 24mmの アルミニウム板(材質1050、調質H16)を26% 水酸化カリウム、温度75℃でスプレーによるエッチン グ処理を行い、水洗洗浄した。次いで1%塩酸水溶液、 温度30℃でスプレーによるデスマット処理を行い後に 水洗洗浄した。そして1%塩酸水溶液、温度35℃で連 30 続式直流電圧粗面化を行った。条件は、直流電圧のリッ プ率10%、電流密度25A/ d m²、電気量100C /dm²とした。その後、水洗洗浄を行った。次いで2 6%水酸化カリウム、温度75℃でスプレーによるエッ チング処理を行い、水洗洗浄した。1%硝酸水溶液、温 度30℃でスプレーによるデスマット処理を行い後に水 洗洗浄した。1%硝酸水溶液で、温度45℃で連続式交 流電圧粗面化を行った。条件は、電流密度60A/dm 2、電気量230C/dm2で行い、処理後水洗洗浄を行 った。次いで5%水酸化カリウム、温度75℃でスプレ 40 ーによるエッチング処理を行い、水洗洗浄した。15% 硫酸水溶液、温度60℃でスプレーによるデスマット処 理を行い、水洗洗浄を行った。これを15%硫酸水溶 液、温度35℃、電流密度2A/dm²で直流電圧で陽 *

> バインダーA バインダーB 分子量;38000 酸分解化合物B 光酸発生剤(例示(1)) シアニン色素(例示IR-15) 界面活性剤(旭硝子S-381)

*極酸化を行い、水洗により洗浄を行い支持体の作製を行った。

【0149】〈支持体18の作製〉厚さ0.24mmの アルミニウム板(材質1050、調質H16)を26% 水酸化カリウム、温度75℃でスプレーによるエッチン グ処理を行い、水洗洗浄した。1%塩酸水溶液、温度3 0℃でスプレーによるデスマット処理を行い、水洗洗浄 した。1%塩酸水溶液、温度35℃で連続式直流電圧粗 面化を行った。条件は、直流電圧のリップ率10%、電 流密度25A/dm²、電気量100C/dm²とした。 その後水洗洗浄を行った。次いで26%水酸化カリウ ム、温度75℃でスプレーによるエッチング処理を行 い、水洗洗浄した。1%硝酸水溶液、温度30℃でスプ レーによるデスマット処理を行った後水洗洗浄した。1 %硝酸水溶液、温度45℃で連続式交流電圧粗面化を行 った。条件は、電流密度60A/dm²、電気量230 C/dm²とし、処理後水洗洗浄を行った。次いで5% 水酸化カリウム、温度75℃でスプレーによるエッチン グ処理を行い、水洗洗浄した。15%硫酸水溶液、温度 60℃でスプレーによるデスマット処理を行い、水洗洗 浄を行った。これを15%硫酸水溶液、温度35℃、電 流密度2A/dm²で直流電圧で陽極酸化を行い、水洗 洗浄を行った。支持体表面に断熱層を有する目的で、8 5℃に保たれたPVPAの水溶液(濃度0.1wt%) に30秒浸漬した後、80℃で5分間乾燥し、支持体を 作製した(断熱材:PVPAの付き量0.01mg/m ²) 。

【0150】〈酸分解化合物Bの合成〉500ml三口フラスコにシクロヘキサノンジメチルアセタール57.68g(0.4mol)、ジエチレングリコール42.45g(0.4mol)、pートルエンスルホン酸一水和物0.19g(0.001mol)、及びトルエン200mlを仕込み、還流加熱で反応した。分水器で20分に一度トルエンとメタノールを除き、新しいトルエンを追加した。8時間反応させ反応終了とした。

【0151】放冷した後反応物を水で洗浄し、水酸化ナトリウムで中和洗浄し、脱水後、反応物を減圧濃縮によりワックス状の酸分解化合物B(分子量1200、収率72.1%)を得た。

【0152】次に、以下のように感光層3用の感光性組成物3を作製した。

【0153】(感光性組成物3の作製)以下に示すような割合で混合し感光性組成物とした。

[0154]

60.75重量部 15重量部 20重量部 3重量部 1重量部

0.25重量部

溶剤 (PGM)

上述した支持体 $11\sim18$ 上に、実施例1で用いた感光層1及び上記の如く得られた感光層3の塗布液を乾燥後の膜厚が $2.0g/m^2$ になるようにワイヤーバー塗布を行ない、95℃で90秒間乾燥して平版印刷版を得た。尚、支持体の特性は表3参照。

【0155】 (画像形成) 得られた平版印刷版を、半導体レーザー (波長 $830\,\mathrm{nm}$ 、出力 $500\,\mathrm{mw}$) で画像露光を行なった。レーザー光径はピークにおける強度の $1/\mathrm{e}^2$ で $13\,\mu\,\mathrm{m}$ であった。又、解像度は走査方向、副走査方向とも $2000\,\mathrm{d}\,\mathrm{p}$ i とした。画像露光の後、

コニカPS版用現像液SDR-1 (コニカ (株) 製) と*

68

*水との比が1:5となるよう希釈した。その後30℃に 保った前記現像液に30秒間浸漬し現像を行なった後水 洗乾燥を行ない、画像を形成した。

【0156】得られた画像に対し、実施例1と同様の評価を行った。得られた結果を以下の表3に示す。尚、実施例21~36は態様1における本発明であり、実施例27、28及び35、36は態様2における本発明である。

0 [0157]

【表3】

実施例	感光層	支持体	陽極酸化	Ra	Rz	断熱層素材	断熱層	表面エネルギー	レーサ・ー	トーットケーイ
No.	,		皮膜厚	(μm)	(µ m)		皮膜量	γ(H)	感度	変動率
			(mg/dm²)		!		(mg/m²)	(dyn/cm)	(mJ/cm²)	(%)
21	1	11	20	0.57	4.02	_	0	32.4	150	19
22	3	11	20	0.57	4.02	_	0	32.4	200	18
23	1	12	20	0.53	3. 91	- i	0	24.1	100	21
24	3	12	20	0.53	3. 91	-	Ó	24.1	150	20
25	1	13	20	0.53	3. 91	_	0	28.8	150	22
26	3	13	20	0.53	3. 91	-	0	28.8	150	20
27	1	14	20	0.53	3. 91	PVPA	0.01	30.1	250	26
28	3	14	20	0.53	3. 91	PVPA	0.01	30.1	250	24
29	1	15	31	0.67	4.56	-	D	31.2	100	23
30	3	15	31	0.67	4.56	- 1	0	31.2	150	21
31	1	16	31	0.67	4.56	- 1	o [36.4	300	30
32	3	16	31	0.67	4.56	-	0	36.4	300	28
33	1	17	48	0.61	5.43	- 1	0	40.1	100	17
34	3	17	48	0.61	5.43	-	0	40.1	150	17
35	1	18	48	0.61	5.43	PVPA	0.01	49.3	200	24
36	3	18	48	0.61	5.43	PVPA	0.01	49.3	300	20

【0158】表3から明らかなように、本発明により得られたポジ型或いはネガ型の平版印刷版は、赤外線による露光で画像形成が可能であるのみならず赤外線に対する感度が高く、かつドットゲインの変動の少ない良好な画像を呈することが分かる。

[0159]

【発明の効果】本発明の画像形成材料及び画像形成方法※

※により、近赤外~赤外線領域による露光で画像形成が可能で、特に該領域に発光領域を有するレーザーを用いて 記録することによりコンピューター等のデジタルデータ から直接製版が可能であり、しかも該領域に対する感度 が高く、かつドットゲイン変動率が改善された画像を得 ることができるという顕著に優れた効果を奏する。

フロントページの続き

(51) Int. Cl. ⁶		識別記 号	FΙ		
G 0 3 F	7/039	6 0 1	G 0 3 F	7/039	6 0 1
	7/09	5 0 1		7/09	5 0 1
	7/11	5 0 3		7/11	503
	7/20	5 0 5		7/20	5 0 5